

113學年度第2學期
教室名稱及代號:化材館二樓材料系教室ME205 教室容量:35

列印日期：2025-05-05 列印

星期 節次	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
08:10 09:00 第一節							
09:10 10:00 第二節			6824 磁記錄原理與應用 蔡佳霖				
10:10 11:00 第三節		6880 專題討論(二) 林孟昌	6824 磁記錄原理與應用 蔡佳霖				
11:10 12:00 第四節		6880 專題討論(二) 林孟昌	6824 磁記錄原理與應用 蔡佳霖				
13:10 14:00 第五節							
14:10 15:00 第六節				6833 高熵材料特論 蔡銘洪			
15:10 16:00 第七節	6832 進階儲能材料與元 件 林孟昌		8221 高等元件物理 賴盈至	6833 高熵材料特論 蔡銘洪			
16:10 17:00 第八節	6832 進階儲能材料與元 件 林孟昌		8221 高等元件物理 賴盈至	6833 高熵材料特論 蔡銘洪			
17:10 18:00 第九節	6832 進階儲能材料與元 件 林孟昌		8221 高等元件物理 賴盈至				
18:20 19:10 第A節							
19:15 20:05 第B節							
20:10 21:00 第C節							
21:05 21:55 第D節							